

化学工学会第 53 回秋季大会 材料・界面部会横断型シンポジウム (共催)  
ST-24 CVD・ドライプロセス –構造・機能制御の反応工学– 報告書

オーガナイザー

下山 裕介 (東京工業大学) (文責)

野田 優 (早稲田大学)

川上 雅人 (東京エレクトロン)

百瀬 渉 (ALD ジャパン)

2022 年 9 月 14～16 日にオンライン開催された化学工学会第 53 回秋季大会にて本シンポジウムが開催され、合計 13 件の講演発表が行われた。詳細は下記の通りである。

日時	9 月 14 日 10:00～17:00 13 件(展望講演 1 件、招待講演 1 件を含む)
会場	DJ 会場／オンライン
聴講者数	40 名
展望講演	『フラックスコーティング法が拓く結晶材料フロンティア』○手嶋勝弥氏(信州大 RISM /信州大工)・山田哲也氏(信州大 RISM)・林文隆氏(信州大工)・手島千晶氏(東理大／信州大 RISM) 『機械学習による W-ALD 成膜速度の予測精度向上と応用展開』○会田倫崇氏・山崎英亮氏・堀田隼史氏・川口拓哉氏・成嶋健索氏・久保敦史氏・望月誠一郎氏・高木俊夫氏(東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ)
招待講演	『レーザーを援用した化学気相析出による非酸化物セラミックスの構造と機能』 ○且井宏和氏・堀田幹則氏(産総研)・原田勝可(名大)・下田一哉(NIMS)

以上